## スパッタ法によるBaTiO3ナノ結晶性薄膜の形成

## (群大院工) 松本 友香梨, 京免 徹, 花屋 実

【序】 チタン酸バリウム(BaTiO<sub>3</sub>)は典型的な酸化物強誘電体であるが、誘電材料としての利用においては、SrTiO<sub>3</sub>やCaTiO<sub>3</sub>等の固溶により室温域での誘電特性の制御が行われている。一方、BaTiO<sub>3</sub>の結晶粒径をnmオーダーに制御した場合には、界面エネルギーの増大によって、キュリー温度(*T*<sub>C</sub> = 393 K)の低下や、相転移のブロード化による誘電率の温度依存性の減少が期待され、誘電特性を自在にコントロールできる可能性がある。そこで本研究では、スパッタ法によりBaTiO<sub>3</sub>の薄膜を形成し、スパッタ時の基板温度を制御することによってナノ結晶性薄膜の形成を試みた。そして、形成した結晶性薄膜中の結晶粒径と基板温度との関係を明らかにするとともに、結晶粒径と結晶構造および誘電特性との相関について検討を行った。さらに、アモルファスBaTiO<sub>3</sub>薄膜の結晶化についてアニール温度依存性を追跡し、結晶核生成温度について検討を行った。

【実験】 BaTiO<sub>3</sub>薄膜試料は、RFプレーナマグネトロンスパッタリング装置を使用し、基板 として石英ガラス板およびAI電極を蒸着した石英ガラス板を用い、スパッタ時の基板温度を 室温から 973 Kの範囲で変化させて作製した。作製した薄膜試料の膜厚は、約 1.0 μmであっ た。得られた薄膜試料について、X線回折実験(CuKα線,θ 20法)により結晶構造および 結晶粒径を解析するとともに、交流誘電率測定(100 Hz 1 MHz,200 300 K)によって誘電 特性を検討した。

【結果と考察】 図1に、AI電極を蒸着した石 英ガラス上に形成したBaTiO<sub>3</sub>薄膜試料の室温 X線回折パターンを示す。薄膜形成時の基板温 度 $T_s$  が 573 K以下の試料ではハロパターンの みが観測され、薄膜がアモルファス構造をもつ ことが明らかとなった。また、 $T_s \ge 673$  Kの試 料においてはBaTiO<sub>3</sub>結晶に基づく回折ピーク が観測され、結晶性薄膜の形成が確認された。

図2に結晶性薄膜試料の(100)面の回折ピ ークを拡大して示す。粉末試料において観測さ れる(100)面と(001)面の回折ピークの分離 は見られず、また、(400)面の回折ピークにお いても分離は見られなかった。これより、薄膜 試料中の結晶は、室温において立方晶であると 考えられる。また、T<sub>s</sub>の上昇にともなって回折 ピークの先鋭化と高角シフトが観測された。 (111)面の回折ピーク幅からScherrerの式を用



図1.BaTiO3薄膜試料の室温X線回折パターン.

いて見積もった結晶粒径D、および、(100)面の 回折ピーク位置から算出した面間隔dのT<sub>s</sub>依存性 を図3に示す。T<sub>s</sub>の上昇にともなってDは1020 nmの範囲で連続的に増大し、また、Dの増大にと もなってdは減少することが明らかとなった。石英 ガラス板を基板として用いた場合にも同様の結果 が得られた。このDのT<sub>s</sub>依存性は、T<sub>s</sub>が高い場合に は、基板に到達したスパッタ粒子の面内拡散距離 が大きく、結晶化および結晶成長が進行しやすい ためとして理解される。

以上の結果より、スパッタ法によるBaTiO<sub>3</sub>の薄 膜形成において、スパッタ時の基板温度を 673 K 以上に保つことによって結晶性薄膜が生成する こと、また、基板温度を変化することによって結 晶粒径を 10 nmのオーダーで制御可能であること が明らかとなった。

また、BaTiO<sub>3</sub>結晶性薄膜試料の1 kHzにおける 誘電率は、測定を行った 200 300 Kの温度域で、 結晶粒径が大きくなるにしたがって増大し、D ~15 nmで最大となり、さらに結晶粒径が大きくな ると減少する傾向が見られた。

結晶核生成温度の検討は、アモルファス薄膜試 料を 673 748 K で 5 時間アニールした後、773 K に昇温して X 線回折実験を行い、(110)面による 回折ピークの面積強度の時間変化を追跡するこ とにより行った。結果を図4に示す。673,698 K でアニールした試料は、アニールを行わずに773 K に昇温した試料の場合とほぼ一致する時間変化 を示した。748 K アニール試料では、748 K におい て結晶化が進行し、773 K に昇温する以前に回折 ピークが観測された。一方、723 K アニール試料 では、723 K における結晶化は観測されず試料は アモルファスのままであったが、773 K への昇温 直後から結晶化の進行が観測された。これは、723 K では結晶化の初期過程である結晶核生成のみが 進行する可能性を示し、興味がもたれる。



図2.BaTiO3結晶性薄膜試料の(100)面の 回折ピーク.







図4.BaTiO<sub>3</sub>結晶の(110)面による回折 ピークの面積強度の773 Kにおける時間 変化.